



# (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205927221 U

(45)授权公告日 2017.02.08

(21)申请号 201620869760.0

(22)申请日 2016.08.10

(73)专利权人 浙江唯胜园林建设有限公司

地址 311899 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街  
道良塔东路127号8楼

(72)发明人 黄薇

(51)Int.Cl.

B23B 47/28(2006.01)

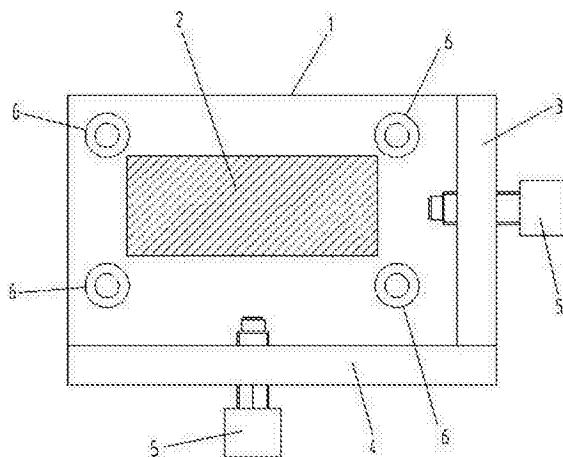
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

## (54)实用新型名称

割草机新型花键支架钻模

## (57)摘要

本实用新型公开了割草机新型花键支架钻模,包括钻模板、定位块、横条一、横条二、固定螺丝、钻套,钻模板设若干钻套,侧设定位块,定位块右端设横条一,下端设横条二,横条一、横条二均设固定螺丝,本实用新型以定位块与花键支架一的方孔定位,加工安装孔,使加工安装孔的定位与加工半圆弧的定位基准一致,以使安装孔与半圆弧的尺寸和位置度符合技术要求,解决了以往的安装孔与半圆弧的尺寸和位置度凌乱、超差的问题。



1. 割草机新型花键支架钻模,其特征在于:包括钻模板(1)、定位块(2)、横条一(3)、横条二(4)、固定螺丝(5)、钻套(6),所述钻模板(1)设若干钻套(6),侧设定位块(2),所述定位块(2)右端设横条一(3),下端设横条二(4),所述横条一(3)、横条二(4)均设固定螺丝(5)。

## 割草机新型花键支架钻模

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种园林机械装备类技术领域,尤其是割草机新型花键支架钻模。

### 背景技术

[0002] 如图3、图4所示:割草机的花键支架一1001的半圆弧1004与安装孔1002有较高的位置尺寸,半圆弧1004的加工时,需要定位基准,因花键支架一1001的毛坯外形有较大误差,不适合作定位基准,常常把方孔1003加工到规定尺寸作为工艺定位基准,以此使得半圆弧1004处于花键支架一1001的中心位置,但是安装孔1002加工时,常常用外形定位来加工,定位基准的不统一,导致安装孔1002余半圆弧1004的位置度有随机性的偏差,超出技术要求,导致花键支架一1001安装后,半圆弧1004的位置有偏差。

### 实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题,本实用新型的目的在于提供割草机新型花键支架钻模,包括钻模板、定位块、横条一、横条二、固定螺丝、钻套,钻模板设若干钻套,侧设定位块,定位块右端设横条一,下端设横条二,横条一、横条二均设固定螺丝,本实用新型以定位块与花键支架一的方孔定位,加工安装孔,使加工安装孔的定位与加工半圆弧的定位基准一致,以使安装孔与半圆弧的尺寸和位置度符合技术要求,解决了以往的安装孔与半圆弧的尺寸和位置度凌乱、超差的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:割草机新型花键支架钻模,包括钻模板、定位块、横条一、横条二、固定螺丝、钻套,所述钻模板设若干钻套,侧设定位块,所述定位块右端设横条一,下端设横条二,所述横条一、横条二均设固定螺丝。

[0005] 本实用新型的有益效果是:本实用新型以定位块与花键支架一的方孔定位,加工安装孔,使加工安装孔的定位与加工半圆弧的定位基准一致,以使安装孔与半圆弧的尺寸和位置度符合技术要求,解决了以往的安装孔与半圆弧的尺寸和位置度凌乱、超差的问题。

### 附图说明

[0006] 图1为本实用新型的示意图;

[0007] 图2为图1的俯视图;

[0008] 图3为花键支架一的示意图;

[0009] 图4为图3的左视图。

[0010] 图中:钻模板1、定位块2、横条一3、横条二4、固定螺丝5、钻套6、花键支架一1001、安装孔1002、方孔1003、半圆弧1004。

### 具体实施方式

[0011] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0012] 如图1~图2所示,割草机新型花键支架钻模,包括钻模板1、定位块2、横条一3、横条二4、固定螺丝5、钻套6,所述钻模板1设若干钻套6,侧设定位块2,所述定位块2右端设横条一3,下端设横条二4,所述横条一3、横条二4均设固定螺丝5,本实用新型以定位块2与花键支架一1001的方孔定位1003,加工安装孔1002,使加工安装孔的定位与加工半圆弧的定位基准一致,以使安装孔与半圆弧的尺寸和位置度符合技术要求,解决了以往的安装孔与半圆弧的尺寸和位置度凌乱、超差的问题。

[0013] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征,以及本实用新型的优点。本行业的技术人员也了解,本实用新型不受上述实施案例的限制,上述实施案例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型连接计范畴前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

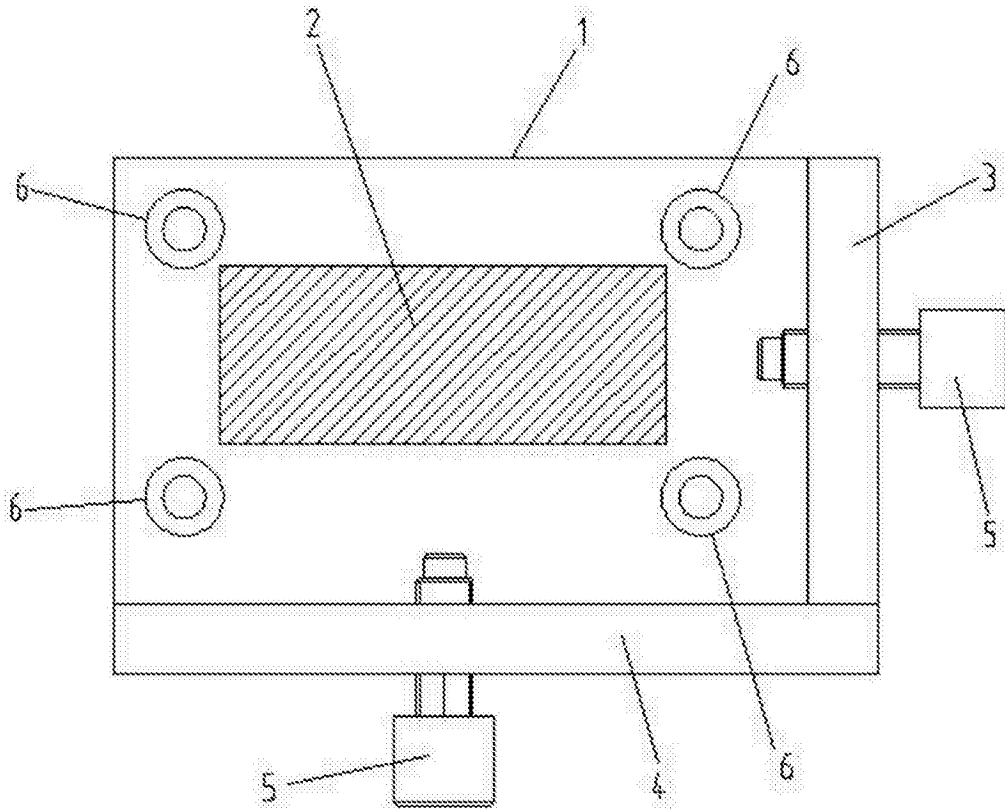


图1

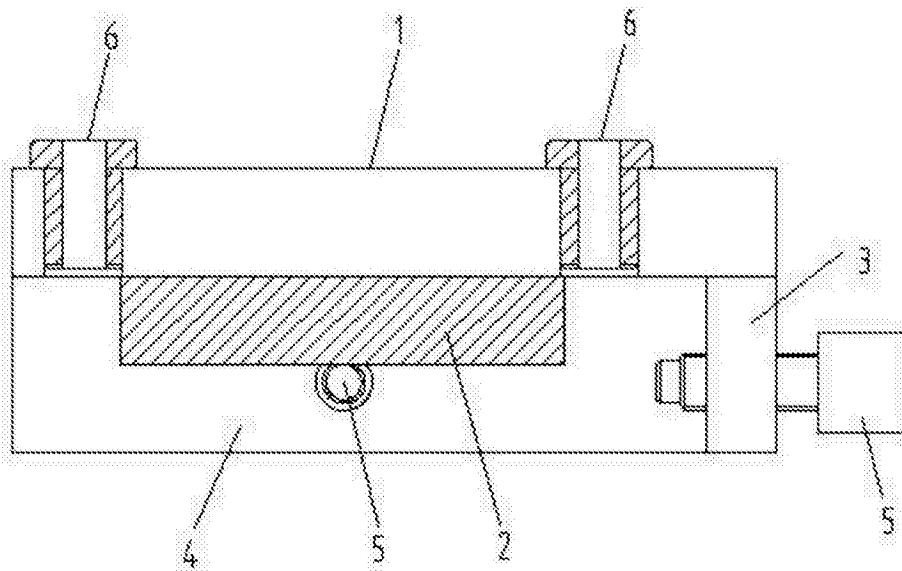


图2

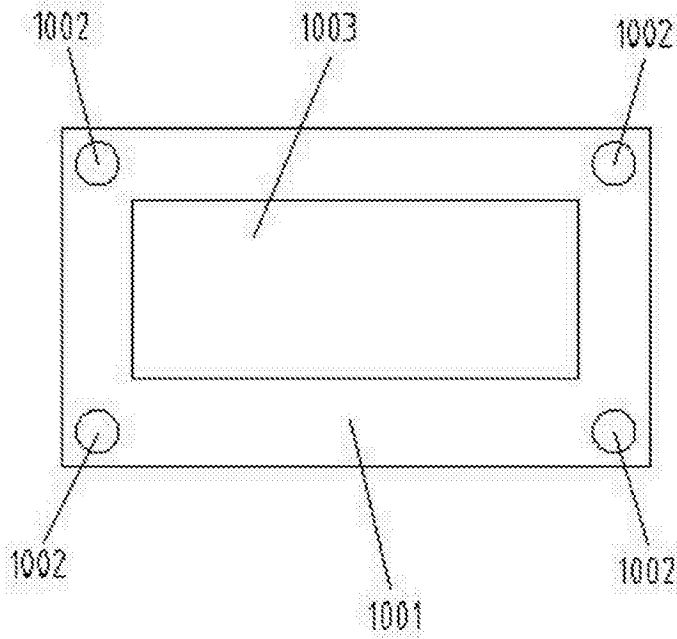


图3

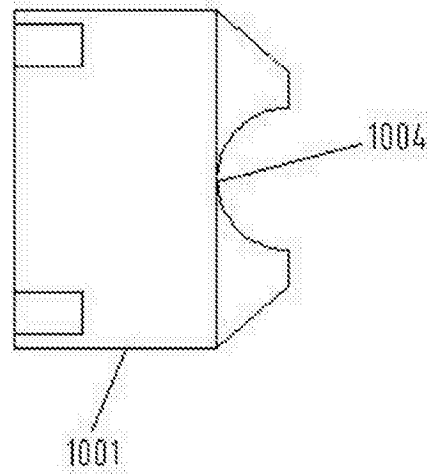


图4